



2015年12月25日

報道関係者各位

DIC株式会社

〒103-8233 東京都中央区日本橋3-7-20

ディーアイシービル

総合研究所に技術棟の新設を決定

最先端領域の研究開発を加速し、事業化までのスピード化を図る

DIC株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：中西義之）は、最先端領域の研究開発を加速するため、総合研究所（千葉県佐倉市）内に、新たに技術棟を建設することを決定しました。

この新技術棟では、エレクトロニクス分野をはじめとする最先端の研究を加速するためのクリーンルームと、先端材料の研究開発を支援するための超高分解能透過型電子顕微鏡（以下、HR-TEM）を導入する計画であり、投資額は全体で約18億円、完成は2017年1月になる予定です。

当社では、当社が有する基盤技術の深耕により、既存の材料を超える高度な機能、あるいは複数の機能を持たせる技術領域、およびそれらの機能を有した製品群の研究開発を進めています。具体的には、バリア材料、放熱材料、ナノ無機材料、プリントエレクトロニクス材料などがテーマとして挙げられています。

先端材料の開発では、温湿度、清浄度、振動などが制御された研究環境と評価技術が開発を加速するための重要な要素であるため、クリーンルームを整備し、例えば、プリントエレクトロニクス関連の印刷評価の確度向上につなげることで、材料開発を加速させていきます。

また、昨今、先端分野の素材開発の過程においてはその表面・界面に対する評価技術が、開発を加速するための重要な要素となってきました。今般導入するHR-TEMは、ナノメートル単位での観察ができるため、界面における元素レベルでの分布や結合の状態を観察、解析することが可能となります。

これらの設備導入による開発環境の整備を進めることで、事業化までの時間が大幅に短縮されることが期待できます。

なお、技術棟を新設する千葉県佐倉市の総合研究所は、さまざまな専門分野の技術者が集まった当社R&Dの中核拠点であることに加え、地盤が安定した地域に立地しており、高精度最先端の分析装置や実験装置を使用した先端分野の研究開発を進める上で、最も相応しい場所であると判断しています。

当社では、引き続きエレクトロニクスなどの最先端素材からパッケージなどの生活素材まで、

Press Release



DIC株式会社

多様な事業領域で研究開発を加速させ、社会とお客様のニーズに対応した製品をいち早く提供できるように努めていく所存です。



技術棟を新設する総合研究所

お問い合わせ先 コーポレートコミュニケーション部

TEL 03-6733-3033